

Печь быстрого термического отжига RTP 100-HV



Производитель:

Unitemp

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Серия	RTP
-------	-----

Описание

Установки UniTemp серии RTP предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин и плоских подложек. Настольные компактные установки RTP прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пилотного и мелкосерийного производства.

Установка RTP 100-HV представляет собой модификацию печи RTP 100 с возможностью работы в высоком вакууме до 10⁻⁶ мбар. Печь работает с

образцами до 100 мм в диаметре. Рабочая нагреваемая область: 100×100 мм. Загрузка подложек в рабочую камеру производится вручную. Максимальная температура процесса — до +1200 С. Максимальная скорость нагрева — до 150 К/с. Возможно проведение процессов в вакууме и газовой среде. Управление осуществляется при помощи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Стандартная комплектация

- Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 4 шт.)
- Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, покрытого SiC
- Дополнительная термopара
- Различные вакуумные насосы
- Чиллер
- Дополнительная рабочая камера